수소생산을 위한 물 분해용 광전극에 도입된 환원된 산화그래핀이 광전기화학성능에 미치는 영향

윤상혁 · 딩진루이 · 김교선[†] 강원대학교 화학공학과

Effect of Reduced Graphene Oxide in Photoanode on Photoelectrochemical Performance in Water Splitting for Hydrogen Production

SANGHYEOK YOON, JIN-RUI DING, KYO-SEON KIM[†]

Department of Chemical Engineering, Kangwon National Univ., 1 Kangwondaehak-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 24341, Republic of Korea

Abstract >> Hydrogen is eco-friendly alternative energy source and the photoelectrochemical water splitting is believed to be one of the promising methods for hydrogen production. Many researchers have studied several potential photocatalysts to increase the photoelectochemical performance efficiency for hydrogen conversion. In this study, the GO (graphene oxide) was prepared by Tour's method and was dispersed in precursor solutions of WO₃ and BiVO₄. Those precursor solutions were spin-coated on FTO glass and several photocatalyst thin films of WO₃, BiVO₄ and WO₃/BiVO₄ were prepared by calcination. The morphologies of prepared photocatalyst thin films were measured by scanning electron microscope. The photoelectrochemical performances of photocatalyst thin films with rGO (reduced graphene oxide) and without rGO were analyzed systematically.

Key words : Hydrogen Production(수소생산), Photoelectrochemical Water Splitting(광전기화학적 물 분해), Photocatalyst(광촉매), Reduced Graphene Oxide(환원된 산화 그래핀)

1. 서 론

화석연료를 대체할 수 있는 친환경 에너지원를 개 발하는 여러 가지 방법 중 광촉매 물질이 태양광에 너지를 받아 물을 분해하여 수소를 생산할 수 있는 광전기화학적 물 분해법은 혼다-후지시마 효과¹⁾가 발표된 이후 계속하여 진행되고 있는 연구 주제이다. 태양빛을 이용하는 광촉매의 물 분해 효율을 향상 시키기 위하여 가시광선영역의 흡수에 유리한 광촉 매의 사용, 도핑을 통한 밴드갭의 조절²⁴⁾, 헤테로접 합을 통하여 생성된 전자과 정공의 분리⁵⁻⁷⁾, 복합체 제조를 통한 전기적 특성 향상⁸⁻¹⁰⁾, 광촉매의 나노구 조 제어¹¹⁻¹²⁾ 등 다양한 방법들이 연구되어 왔다.

본 연구에서는 가시광선영역 흡수에 유리한 밴드 갭을 갖는 WO₃와 BiVO₄를 광전극으로 사용하기 위 하여 박막형태로 제조하였다. 또한 뛰어난 전기적 특 성을 갖는다고 알려진 rGO(reduced graphene oxide) 를 도입하여 박막을 제조한 후 두 경우의 광전기화 학성능을 비교하여 광촉매의 광전기화학성능에 rGO

⁺Corresponding author : kkyoseon@kangwon.ac.kr Received : 2016.7.29 in revised form : 2016.8.11 Accepted : 2016.8.30 Copyright © 2016 KHNES

330

가 미치는 영향을 알아보았다.

2. 실험방법

2.1 GO의 제조

실험에 사용하기 위한 GO를 Tour 법¹³을 통하여 제조하였다. 제조과정을 간단히 설명하면 먼저 황산 (H₂SO₄, 98% GR, Daejung)과 인산(H₃PO₄, 85% GR, Daejung)의 혼합액(9 : 1 부피비)을 흑연(CP, Daejung) 과 과망간산칼륨(KMnO₄, 99.3% GR, Junsei)이 담긴 초자에 부은 후 50°C에서 12시간 동안 교반시키며 산화시켰다. 이후 과산화수소(H₂O₂, 30~35.5% GR, Wako)를 넣어 반응을 종결시키고 묽은 염산과 증류 수를 통해 충분히 세척하였다. 산화된 GO는 초음파 처리를 실시하여 충분히 박리시켰으며 측정을 통하 여 산화 및 박리를 확인하였다¹⁴.

2.2 전구체 수용액의 제조

2.2.1 WO3 전구체

WO₃ 전구체의 경우 25 ml 증류수에 ammonium tungsten oxide hydrate ((NH₄)₆W₁₂O₃₉·xH₂O, Alfa Aesar) 5 g과 PVP (polyvinylpyrrolidone, K30, CP, Daejung) 2.5 g을 용해시켜 제조하였다.

2.2.2 BiVO4 전구체

질산비스무스(Bi(NO₃)₃·5H₂O, ≥98.0% ACS reagent, Sigma-Aldrich) 130 mg을 아세트산(CH₃COOH, 99.9% SSG, Wako) 5 ml에 녹인 용액과 vanadyl acetylacetonate (VO(C₂H₄O₂)₂, 98%, Aldrich) 65 mg을 acetylaceton (C₅H₈O₂) 0.25 ml에 녹인 용액을 섞어 BiVO₄ 전구체 용액을 얻었다.

2.3 광촉매 박막의 제조

제조한 전구체 용액을 FTO (fluorine doped tin oxide)

glass (2 mm 두께, 표면 저항 ~7 Ω/sq, Aldrich) 위에 떨어뜨린 후 WO₃ 전구체는 1000 rpm, BiVO₄ 전구 체는 500 rpm의 속도로 45초 동안 스핀코팅하였다. 그 후 450°C로 4시간동안의 가열을 통하여 단사정계 의 WO₃와 BiVO₄ 광촉매 박막이 제조되었다¹⁴⁾. 헤테 로 접합 박막의 경우 같은 전구체를 앞서와 동일한 스핀코팅 속도 및 가열 조건으로 먼저 WO₃ 박막을 코팅하고 그 위에 BiVO₄ 박막을 코팅하는 방법을 통 해 제조하였다. 또한 전구체 용액 1 ml 당 약 3 mg의 GO를 분산시킨 뒤 같은 제조과정을 실시하였는데 실험과정 중 450°C 의 가열하는 과정에서 GO는 rGO 로 환원되어 rGO를 포함하는 광촉매 박막을 제조할 수 있었다¹⁴⁾. 제조한 광촉매 박막은 UHR-SEM (ultra high resolution scanning electron microscope, Hitachi S-4800) 측정을 실시하였다.

2.4 광전기화학성능의 측정

만들어진 광촉매 박막은 광전극으로 사용하기 위 하여 전도성 에폭시(CW 2400, Hemtronics)와 에폭 시 접착제(Rapid 3ton epoxy, V-tech)를 이용하여 구 리전선과 연결시켰다.

광전극의 광전기화학성능 측정을 위하여 Fig. 1 과 같이 광전기화학성능 측정 장치를 구성하였다. 기 준전극(SCE, saturated calomel electrode), 상대전극 (백금 메쉬), 전해질(0.5M H₂SO₄)과 함께 제조된 광 전극을 이용하여 3 전극 시스템 광전기화학 셀을 구 성하였고 셀에는 제논 램프에서 생성된 빛이 AM 1.5 필터로 유사태양광이 되어 조사된다. 셀에 연결된 potentiostat (VersaSTAT3, Ametek)을 통하여 전압을 공급하며 광전극과 상대전극 각각에서 물 분해에 의 해 진행되는 산소생성반응과 수소생성반응에 따른 생성 전류를 측정한다. 측정된 전류는 단위면적 1 cm² 당 생성하는 전류밀도(j)로 계산하여 인가한 전압에 대한 j-V 곡선을 얻었다.



Fig. 1 Schematic of photoelectrochemical performance measurement system



3.1 WO3 박막의 특성 평가

Fig. 2는 제조한 WO₃ 박막에 대하여 실시한 SEM 측정 결과로 이 때 rGO의 도입이 SEM 측정 결과에



Fig. 2 Cross-sectional view (top) and top view (bottom) SEM images of WO_3 thin film



Fig. 3 j-V curves of WO_3 (broken line) and WO_3-rGO photoanode (solid line)

는 영향을 미치지 않았다. SEM 측정 결과를 통하여 제조된 WO₃ 박막은 수십 nm 크기의 입자들로 이루 어져 있으며 약 800 nm 두께로 약 600 nm 두께의 FTO 층 위에 코팅되어 있음을 볼 수 있다.

Fig. 3은 WO3 전구체를 이용하여 만든 WO3 박막 과 WO3 전구체에 GO를 분산시켜 제조한 rGO가 도 입된 WO3-rGO 박막 두 가지에 대하여 광전기화학성 능을 측정하여 얻은 j-V 곡선이다. 두 곡선의 비교를 통하여 rGO가 포함되지 않은 WO3 박막에 비하여 rGO가 포함된 WO3-rGO 박막이 오히려 더 낮은 광 전기화학성능을 보이는 것을 확인할 수 있다. 이러한 양상을 보이는 것은 몇 가지 이유가 복합적으로 작 용하였기 때문이다. 먼저, 도입된 rGO가 산화확원법 을 통하여 제조되었기 때문에 산화에 의하여 생긴 작용기들이 환원과정에서 완전히 제거되지 않으면 rGO의 전기적 특성에 악영향을 미친다¹⁵⁾. 따라서 사 용된 rGO의 전기적 특성은 WO3에 비하여 크게 뛰어 나지 않을 수 있다. 또 강한 산화과정에서 rGO의 탄 소 격자구조상에 결함을 만들게 되고 이러한 결함은 광 조사에 의해 생성된 전자와 정공이 재결합하는 장소가 될 수 있다. 그리고 포함된 rGO는 WO3 대신 빛을 흡수하여 생성되는 전자 정공이 감소될 수 있 다. 따라서 이 경우 rGO가 도입되어 얻어지는 전기 적 특성 향상효과가 설명한 부정적 영향에 비하여



Fig. 4 Cross-sectional view (top) and top view (bottom) SEM images of $BiVO_4$ thin film

적기 때문에 오히려 광전기화학성능이 감소하였다고 설명할 수 있다.

3.2 BiVO4 박막의 특성 평가

Fig. 4는 제조한 BiVO4 박막의 SEM 측정 결과로 WO3 박막의 경우에 비하여 크기가 큰 수백 nm 입자 들이 불규칙적으로 모여 약 200 nm 두께로 코팅되었 음을 확인할 수 있다. 이 때 전구체 용액의 점도가 비 교적 낮기 때문에 더 낮은 스핀코팅 속도에도 두께 가 얇으면서 불균일한 박막이 생성되었다. 또한 이 경우에도 앞서 WO3 박막의 경우와 마찬가지로 도입 된 rGO는 그 구조에 영향을 주지 않았다.

제조한 BiVO4 광전극과 BiVO4-rGO 광전극의 광 전기화학성능 측정 결과를 Fig. 5의 j-V 곡선을 통해 나타냈다. WO3와 WO3-rGO 광전극을 비교했을 때와 다르게 BiVO4 광전극은 rGO가 도입된 경우에서 더 높은 광전기화학성능을 보였다. 이것은 전기적특성



Fig. 5 j-V curves of $BiVO_4$ (dotted line) and $BiVO_4\mbox{-rGO}$ (solid line) photoanode

이 매우 떨어지는 BiVO4에서 생성된 전자가 비교적 전기적특성이 뛰어난 rGO로 빠르게 전달되면서 정 공과 분리되고 이로 인하여 재결합이 줄어들기 때문 이다⁸⁾. 이러한 전자와 정공의 빠른 분리가 앞서 WO3 의 경우에서 설명한 부정적인 영향들에 비하여 효과 가 크기 때문에 BiVO4 박막의 경우 rGO를 도입하였 을 때 광전기화학성능 향상 효과를 보이게 된다.

3.3 WO₃/BiVO₄ 헤테로접합 박막의 특성 평가

적절한 밴드갭 위치를 갖는 두 광촉매 물질을 헤 테로접합 하는 경우 생성되는 전자와 정공을 각각의 광촉매 물질로 분리하여 재결합을 감소시킬 수 있는 데 WO₃와 BiVO₄는 두 물질의 헤테로접합에 적합한 밴드갭 위치를 갖는다⁶⁻⁷⁾. 따라서 두 광촉매 물질을 헤테로 접합하여 WO₃/BiVO₄ 박막을 제조하였고 앞 서 보았던 rGO가 도입된 BiVO₄ 박막의 광전기화학 성능 향상효과가 헤테로접합 박막에도 효과가 있는 지를 확인하기 위하여 WO₃/BiVO₄-rGO 박막을 제조 하였다.

먼저 Fig. 6의 SEM 측정 결과를 보면 약 600 nm 두께의 FTO 층 위로 약 800 nm 두께의 WO₃ 층이 있고 그 위로 약 200 nm 두께의 BiVO₄ 층이 코팅되 어 헤테로접합 박막이 제조되었음을 확인할 수 있다.



Fig. 6 SEM image of WO₃/BiVO₄ heterojunction thin film

이 경우도 이전과 마찬가지로 rGO의 도입은 생성되는 박막 구조에 영향을 주지 않았다.

광전기화학성능 측정을 통하여 얻은 두 가지 종류 의 헤테로접합 박막의 j-V 곡선을 앞선 WO₃ 광전극 의 j-V 곡선과 비교하여 Fig. 7로 나타냈다.

Fig. 7의 j-V 곡선의 비교를 통하여 rGO가 도입되 지 않은 헤테로접합 박막의 경우 WO3 박막에 비하 여 오히려 광전기화학성능이 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 이것은 전자와 정공의 필요이동거리가 늘어 나 재결합이 늘어나기 때문이다¹⁶⁾. WO₃/BiVO₄ 헤테 로 접합 박막에 빛이 조사되면 WO3와 BVO4 두 층 모두에서 전자와 정공이 생성된다. 이 중 WO3 층에 서 생성된 정공은 BiVO4 층으로 전달되어 BVO4 층 을 이동해야한다. 또한 BiVO4 층에서 생성된 전자는 이로 인하여 더 많아진 정공과 BiVO4의 낮은 전기적 특성을 극복한 적은 수의 전자만이 WO3 층으로 이 동할 수 있다. 이렇게 전달된 전자는 WO3 층을 이동 하는 도중에도 생성되는 정공을 만나 재결합될 수 있다. 반면에 WO₃/BiVO₄-rGO 박막의 경우 도입된 rGO에 의하여 BiVO4 층에서 생성된 전자들 중 많은 수가 WO3 층으로 빠르게 전달될 수 있기 때문에 이 로 인하여 광전기화학성능이 증가할 수 있다.

4. 결 론

가시광선영역의 빛에 활성을 보이는 WO3와 BiVO4



Fig. 7 j-V curves of WO_3 (broken line), $WO_3/BiVO_4$ (dotted line) and $WO_3/BiVO_4$ -rGO (solid line) photoanode

를 박막형태로 코팅하고 광전극을 제조하였다. 이때 각각의 광전극에 rGO를 도입하여 그 영향을 확인하 였다. 그 결과 BiVO4 박막의 경우 rGO에 의하여 광 전기화학성능 향상효과를 보였지만 WO3 박막의 경 우 오히려 rGO가 도입되면 광전기화학성능이 떨어 지는 결과를 보였다. 이를 바탕으로 WO3 박막 위에 rGO가 도입된 BiVO4 층을 헤테로접합한 WO3/BiVO4rGO 박막을 제조하였고 광전기화학성능 측정을 통 하여 성능향상 효과를 확인하였다.

후 기

본 연구는 미래창조과학부 지원 한국연구재단 중 견연구사업(NRF-2016R1A2B4008876)으로 수행되었 습니다. 기기분석은 강원대학교 공동실험실습관 지원 으로 수행되었습니다.

References

- A. Fujisima and K. Honda, "Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode", *Nature*, 238, 1972, pp. 37-38.
- A. Zaleska-medynska and A. Zaleska, "Doped-TiO₂ : a review", *Recent Patents on Engineering* Vol. 2, No. 3, 2008, pp 157-164.
- 3. D. Won, J. Kim, T. Jin, and J. Sung, "Mg-doped

WO₃ as a novel photocatalyst for visible light-induced water splitting", *Catalysis lett.*. Vol. 80, 2002, pp. 53-57.

- Y. Nah, I. Paramasivam, R. Hahn, N. K. Shrestha, and P. Schmuki, "Nitrogen doping of nanoporous WO₃ layers by NH₃ treatment for increased visible light photoresponse", *Nanotechnology* Vol. 21, 2010, 105704.
- P. Chatchai, Y. Murakami, S. Kishioka, A. Y. Nosaka, and Y. Nosaka, "Efficient photocatalytic activity of water oxidation over WO₃/BiVO₄ composite under visible light irradiation", *Electrochim. Acta*, Vol. 54, 2009, pp. 1147-1152.
- P. Chatchai, S. Kishioka, Y. Murakami, A. Y. Nosaka, and Y. Nosaka, "Enhanced photoelectrocatalytic activity of FTO/WO₃/BiVO₄ electrode modified with gold nanoparticles for water oxidation under visible light irradiation", *Electrochimica Acta*. Vol. 55, 2010, pp. 592-596.
- H. Wang, L. Zhang, Z. Chen, J. Hu, and S. Li, "Semiconductor heterojunction photocatalysts : design, construction, and photocatalytic perfomances", *Chem. Soc. Rev.*, 43, 2014, pp. 5234-5244.
- Y. H. Ng, A. Iwase, A. Kudo, and R. Amal, "Reducing Graphene Oxide on a Visible-Light BiVO₄ Photocatalyst for an Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting", *J. Phys. Chem. Lett.*, Vol. 1, No. 17, 2010, pp. 2607-2612.
- N. J. Bell, Y. H. Ng, A. Du, H. Coster, S. C. Smith, and R. Amal, "Understanding the Enhancement in Photoelectrochemical Properties of Photocatalytically

Prepared TiO₂ - Reduced Graphene Oxide Composite", J. Phys. Chem. C, Vol. 115, 2011, pp. 6004-6009.

- F. K. Meng, J. T. Li, S. K. Cushing, J. Bright, M. J. Zhi, J. D. Rowley, Z. L. Hong, a Manivannan, a D. Bristow, and N. Q. Wu, "Photocatalytic Water Oxidation by Hematite/Reduced Graphene Oxide Composites", ACS Catal., Vol. 3, 2013, pp. 746-751.
- J. Ding and K. Kim, "Facile growth of 1-D nanowire-based WO₃ thin films with enhanced photoelectrochemical performance", *AIChE J.*, Vol. 62, No. 2, 2016, pp. 421-428.
- J. Ding and K. Kim, "Rapid growth of vertically aligned tungsten oxide nanostructures by flame vapor deposition process", *Chemical Engineering J.*, Vol. 300, 2016, pp. 47-53.
- D. C. Marcano, D. V. Kosynkin, J. M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, L. B. Alemany, W. Lu, and J. M. Tour, "Improved synthesis of graphene oxide", *ACS Nano*, Vol. 4, 2010, pp. 4806–4814.
- Sanghyeok Yoon, "Improvement of Photoelectrochemical Efficiency by Preparation of Composite Photocatalyst Nanofilms", *Master's Thesis*, Kangwon National University, Gangwon-do, Republic of Korea, 2016.
- H. A. Becerril, J. Mao, Z. Liu, R. M. Stoltenberg, Z. Bao, and Y. Chen, "Evaluation of solution-processed reduced graphene oxide films as transparent conductors", *ACS Nano*, Vol. 2, No. 3, 2008, pp. 463–470.
- J. Su, L. Guo, N. Bao, and C. a Grimes, "Nanostructured WO₃/BiVO₄ heterojunction films for efficient photoelectrochemical water splitting.", *Nano Lett.*, Vol. 11, No. 5, 2011, pp. 1928–1933.